

ПОЗИТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ AZ 4500

AZ-4500 – это серия толстослойных фоторезистов для микроэлектроники с толщиной покрытия свыше 3 мкм. Состав толстослойных фоторезистов существенно отличается от состава тонких фоторезистов. Обусловлено это экспоненциально возрастающим с увеличением толщины покрытия, так называемым «объемным эффектом».

Кроме того, проведение фотолитографии на толстослойном фоторезисте требует соблюдения особых предосторожностей <http://www.frast.ru/thickresist.html>.

Фоторезист AZ-4562 обеспечивает толщину слоя 10 мкм при одноступенчатом нанесении центрифугированием. Специальной техникой нанесения толщина слой может быть доведена вплоть до 50 мкм.

В таблице 1 представлены толщины слоя фоторезистов AZ 4533 и AZ 4562 в зависимости от числа оборотов центрифуги.

Число оборотов центрифуги, об/мин	2000	3000	4000	5000	6000
AZ 4533	4,67	3,81	3,30	2,95	2,69
AZ 4562	8,77	7,16	6,20	5,55	5,06

Для проявления этих фоторезистов используется буферный проявитель AZ-351В на основе едкого натрия.

В качестве растворителя используется экологически безопасный растворитель метоксипропилацет. Фоторезист следует хранить при температурах в пределах 0 °С -25 °С. Срок гарантийного хранения ограничен и зависит от конкретной модификации этой серии. Этот срок указывается на каждой бутылке.